Professional Group of Interfacial Nano Electrochemistry
界面ナノ電子化学研究会　貢献賞　2025

Interfacial Nano Electrochemistry

貢献賞授与について

界面ナノ電子化学研究会の発展に顕著な貢献をなしたものに授与し功績を称える

- **故青木 秀充先生（大阪大学）**が2012年受賞
  業界関係者に呼びかけ、半導体洗浄プロセスをより学術的なアプローチとすべく本研究会の礎となる新領域グループをつくられ、現在の界面ナノ電子化学研究会立ち上げ、この分野の地位向上に貢献された

- **冨田 寛様（SCREEN）・岩元 勇人様（ソニー）**が2016年受賞
  青木先生のお考えに賛同され立ち上げ当初より当研究会をけん引し、後に委員長を務められ当研究会の更なる発展に貢献された

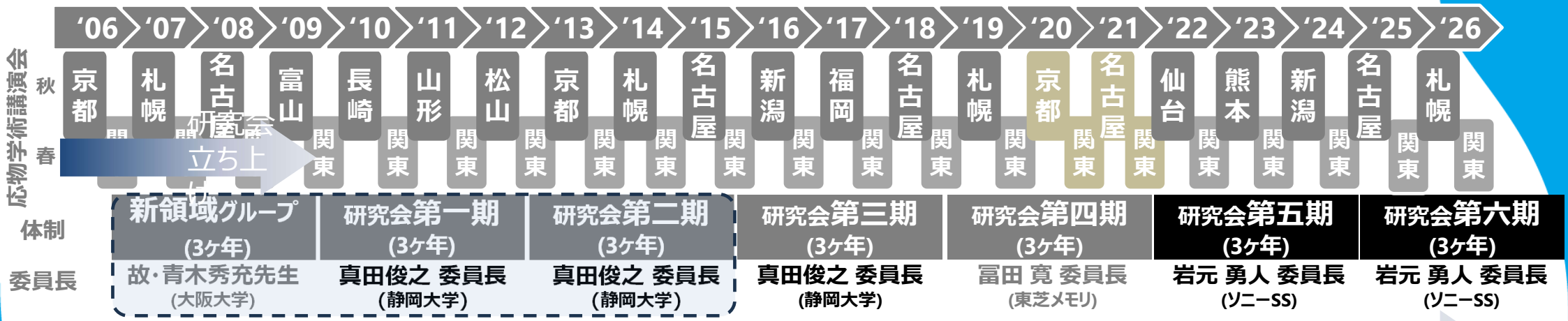
- **荒木 浩之様（SCREEN）・真田 俊之先生（静岡大学）**が2024年受賞
  第1回活動から中心となり活動を支えて頂いた。研究会のほぼ全ての活動（学会活動・ポスター発表展・フォーラム・カサロス）についてけん引役を担い、研究会の発展に貢献された

受賞対象者

- 「応用物理学会界面ナノ電子化学研究会貢献賞規程」に則り、
  岩元委員長の下、選考委員会を立ち上げられ、本日ここに表彰を行います。

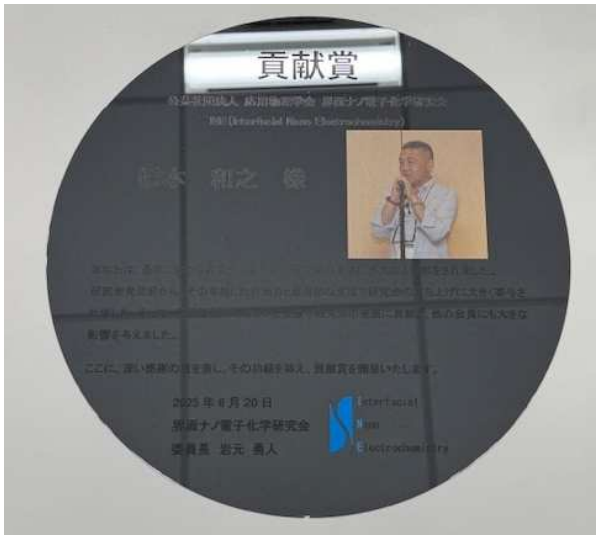
長瀬産業
橋本　和之　様

界面ナノ電子化学研究会の軌跡と橋本様の貢献



橋本様	研究会発足前より指南役として研究会の立ち上げに大きく寄与されました。発足後もほぼ全ての活動（上図の学会活動・ポスター発表展・フォーラム・カサロス）についてけん引役を担っていただき、特にポスター展での会場提供による交流環境の創出を携わり、研究会の発展に大きく寄与されました。

感謝



300mmウェーハで作成した貢献賞を感謝をこめて研究会よりお贈りいたします。
今後もさらなるご活躍を祈念し、引き続き研究会活動も支えていただけますようお願いいたします。

※ウェーハ寄贈：ソニーセミコンダクタソリューションズ様、ありがとうございました
※写真は昨年秋のINEF2024@鳥取でのスピーチ時